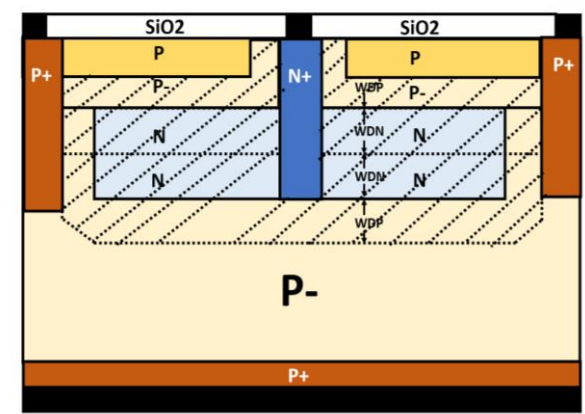
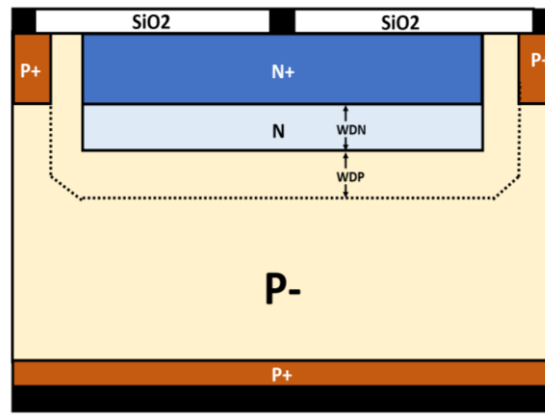
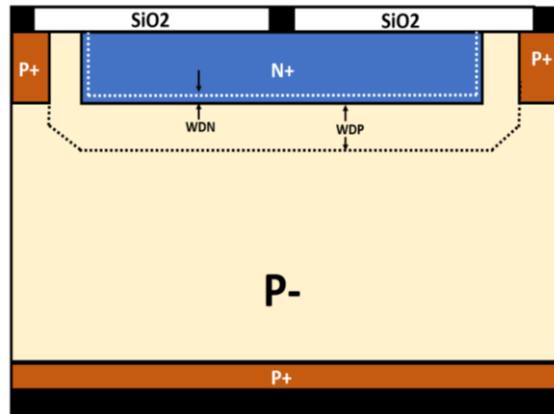


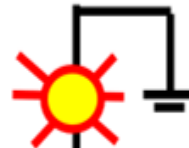
(A) 従来のSingle N+P-P+接合型 (B) Single N+NP-P+接合型 (C) Double P+PP-NP-P+接合型



(D) Double P+PP-NP-P+接合型太陽電池 (Silicon Etching by KOH)

[How to make Multi Junction Solar Cell Yoshiaki Hagiwara.html](http://How_to_make_Multi_Junction_Solar_Cell_Yoshiaki_Hagiwara.html)

3 cm x 3 cm の chip では、側面と裏面に同時に P + 熱拡散領域が形成できて工程が簡略化される。



受光表面のPP-領域は再結合防止膜として機能し、受光表面近傍で光電変換された光電子(e-)とホール(Si+) のペアはすぐには再結合せず変換効率に寄与する。

